

(51) 国際特許分類6 H01L 21/027, G03F 7/22	A1	(11) 国際公開番号 (43) 国際公開日 1999年4月15日(15.04.99) WO99/18604
(21) 国際出願番号 PCT/JP98/04536 (22) 国際出願日 1998年10月7日(07.10.98) (30) 優先権データ 特願平9/274173 1997年10月7日(07.10.97) JP 特願平9/291807 1997年10月9日(09.10.97) JP 特願平10/283898 1998年10月6日(06.10.98) JP (71) 出願人 株式会社 ニコン(NIKON CORPORATION)[JP/JP] 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号 Tokyo, (JP) (72) 発明者 鈴木広介(SUZUKI, Kousuke) 恩田 稔(ONDA, Minoru) 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号 株式会社 ニコン内 Tokyo, (JP) (74) 代理人 弁理士 井上義雄, 外(INOUE, Yoshio et al.) 〒103-0027 東京都中央区日本橋3丁目1番4号 画廊ビル3階 Tokyo, (JP)		(81) 指定国 AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, GB, GE, GH, GM, HU, ID, IL, IS, KE, KG, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MD, MG, MK, MN, MW, MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, UA, UG, UZ, VN, YU, ZW, ARIPO特許 (GH, GM, KE, LS, MW, SD, SZ, UG, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), 欧州特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OAPI特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG). 添付公開書類 国際調査報告書 請求の範囲の補正の期限前の公開; 補正書受領の際には再公開される。
(54)Title: PROJECTION EXPOSURE METHOD AND APPARATUS (54)発明の名称 投影露光方法及び装置 (57) Abstract A projection exposure apparatus comprising a projection optical system adapted to project a pattern of a mask onto a photosensitive base plate, parallel planar plates disposed on the side of the photosensitive base plate of the projection optical system so that the parallel planar plates extend at substantially right angles to the optical axis of the projection optical system, and a regulator adapted to regulate at least one of an angle of inclination of normal of the parallel planar plates with respect to the optical axis of the projection optical system and a direction in which the parallel planar plates are inclined. A ... FROM 40 B ... TO MT1, MT2, MT3,		